



新製品：フォトマスクレーザー描画装置Sigma7700を発表

2010年11月24日ーMicronic Mydata AB(マイクロニック・マイデータ、本社：スウェーデン、日本法人：マイクロニックジャパン株式会社、東京都府中市、代表取締役社長：河田卓)は本日、22nmテクノロジーノードまでの大部分のフォトマスク製造に対応するレーザー描画装置Sigma 7700を発表しました。DUVレーザーを搭載したSigmaシリーズの最新モデルであり、最先端レーザー描画装置の新たな標準をご提供します。

Sigma7700の心臓部には第三世代SLM(空間光変調器)が採用され、これまでにない高精度を実現します。高解像度キャリブレーションカメラとの組み合わせで、画質を新たな高みへと引き上げました。Sigmaプラットフォームに加えられた系統的な改良により、位置精度をより厳しく制御できるようになりました。本最新モデルには描画品質を更に向上させる新機能ミラーイコライザーを搭載しました。

マイクロニック・マイデータ社長兼CEO Peter Uddforsのコメント：

「先端半導体製造に必要なマスクの大部分は、レーザー描画装置で最もコスト効率良く描画することが可能であり、Sigma7700はこの可能性を更に広げます。この装置は、半導体マーケットにコスト効率の高い描画装置をご提供し続けるというマイクロニック・マイデータのコミットメントを示すものです。」

*** 本件に関するお問い合わせ先 ***

マイクロニックジャパン株式会社

Tel: 042-354-1329 Fax: 042-354-1321

広報担当 梁瀬 恵美子

E-mail: info@micronic.co.jp